#### 课程内容

- •研究主体: 半导体中的电子
- 第一部分: 晶体结构
- 第二部分: 能带结构
- 第三部分: 热力学统计
  - 研究半导体中载流子数目在不同温度下的行为
- 第四部分: 载流子输运
- 第五部分: 非平衡载流子

### 小结: 温度和费米分布

- 确定的温度对应某种确定的粒子能量分布
- •对于电子,该分布为费米分布

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

其中E代表能量,E<sub>F</sub>表示费米能级,k<sub>B</sub>为玻尔兹曼常数,T为温度 f(E)表示粒子占据能量为E的态的概率

- f(E)表示一个态中电子的平均个数
- <u>当状态数为g时,gf(E)表示能量为E的态中电子的</u> <u>(平均)个数</u>
- <u>当态密度为g(E)时,g(E)f(E)dE表示能量为E到</u> E+dE的态中电子的个数,积分得到载流子浓度

### 小结: 半导体的载流子浓度

导带电子浓度  $n = \int \frac{1}{V} g_C(E) f(E) dE$ 

导带C: 态密度g<sub>c</sub>(E)

施主D: 状态数VN<sub>D</sub>

N<sub>D</sub>: 施主浓度

受主A: 状态数VN<sub>A</sub>

N<sub>D</sub>: 受主浓度

价带V: 态密度g<sub>v</sub>(E)

电子数g<sub>C</sub>(E)f(E)dE

电子数VN<sub>D</sub>f(E)

电子数VN<sub>A</sub>f(E) 空穴数VN<sub>A</sub>(1-f(E))

电子数g<sub>v</sub>(E)f(E)dE 空穴数g<sub>v</sub>(E)(1-f(E))dE

V: 半导体体积

价带空穴浓度 
$$p = \int \frac{1}{V} g_V(E) (1 - f(E)) dE$$

### 非简并半导体的载流子浓度

玻尔兹曼

导带电子浓度  $n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$ 

导带C: 状态数VNc

N<sub>c</sub>: 导带等效状态浓度

施主D: 状态数VN<sub>D</sub>

N<sub>D</sub>: 施主浓度

受主A: 状态数VN<sub>A</sub>

Nn: 受主浓度

价带V: 态密度VN<sub>V</sub>

N<sub>v</sub>: 价带等效状态浓度

■ 电子数VN<sub>c</sub>f(E<sub>c</sub>)

电子数VN<sub>D</sub>f<sub>D</sub>(E<sub>D</sub>)

电子数VN<sub>A</sub>f<sub>A</sub>(E<sub>A</sub>) 交交数VN (1-f (F )

空穴数VN<sub>A</sub>(1-f<sub>A</sub>(E<sub>A</sub>))

电子数VN<sub>V</sub>f(E<sub>V</sub>)

空穴数VN<sub>V</sub>(1-f(E<sub>V</sub>))

V: 半导体体积

价带空穴浓度  $p = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$  玻尔兹曼

要求:非简并  $-E_c$ 、 $E_v$ 和 $E_F$ 足够远(>几个 $k_B$ T,"几"至少要有2.5)

# 小结: 本征半导体

• 未掺杂 (掺杂补偿) 半导体

电子-空穴浓度乘积

$$np = n_i^2 = N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}} = \frac{(m_{dn}^* m_{dp}^*)^{3/2}}{2\pi^3 \hbar^6} (k_B T)^3 e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$

- 本征载流子浓度n<sub>i</sub>与材料和 温度有关
- 同一材料,随温度升高而迅速增大
- •同一温度下,Eg越大,ni越小

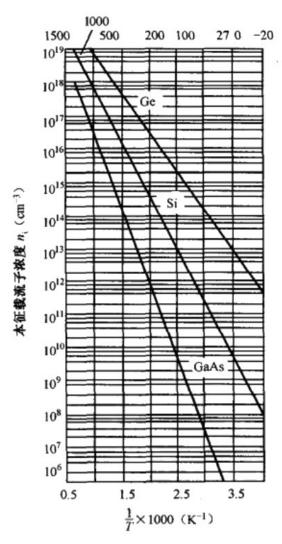


图 3-7 硅、锗、砷化镓 的  $\ln n_i \sim 1/T$  关系<sup>[5]</sup>

### 小结: 掺杂半导体

- 多子
- 1. 低温弱电离区
- 2. 中间电离区
- 3. 强电离区(饱和)
- 4. 过渡区
- 5. 高温本征激发区
- •注意:少子浓度在非简并条件下一直都可以用np=n<sub>i</sub><sup>2</sup>计算

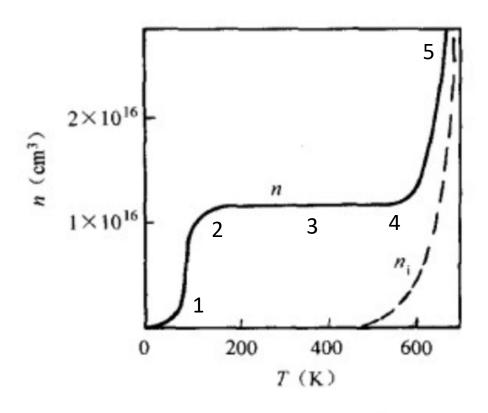
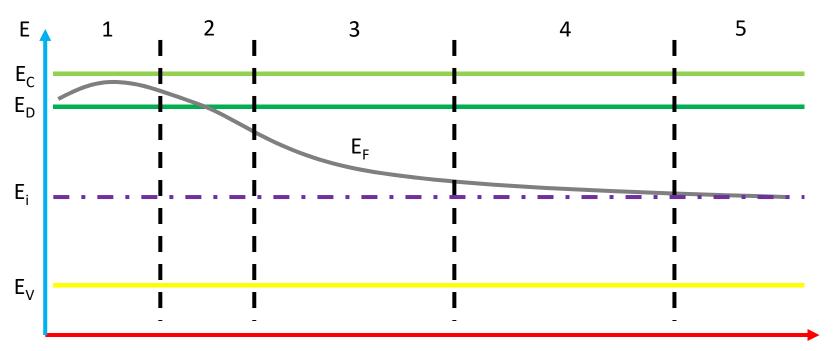


图 3-11 n型硅的电子浓度与 温度的关系<sup>[8,9]</sup>曲线

#### n型半导体的费米能级

- 1. 低温弱电离区
- 2. 中间电离区
- 3. 强电离区

- 4. 过渡区
- 5. 高温本征激发区



# n、p和EF随杂质浓度的变化

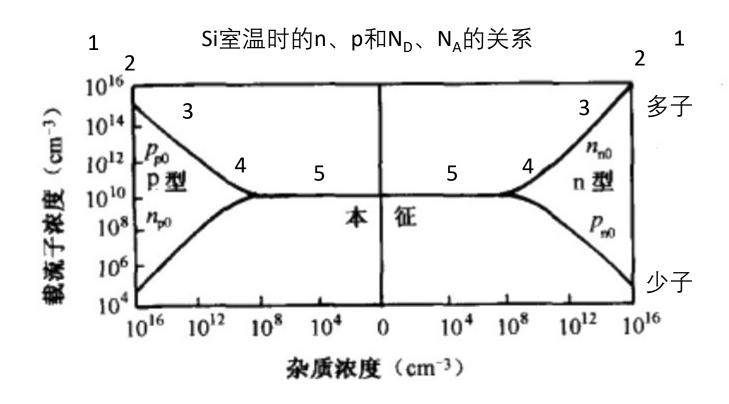


图 3-14 硅中载流子浓度与杂质浓度的关系

掺杂在一开始不影响载流子浓度。超过本征浓度之后,掺得越多载流子浓度越高

# n、p和E-随杂质浓度的变化

掺杂浓度越高,载流子浓度越高 掺杂浓度越高, E<sub>F</sub>越靠近带边

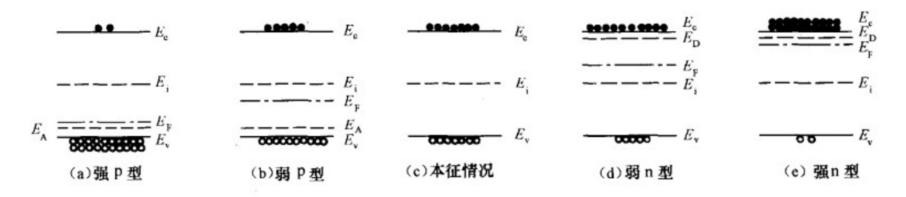


图 3-13 不同掺杂情况下的半导体的费米能级

# 霍耳效应

- 霍耳效应
  - 垂直的均匀磁场和电流产生正比于其值的横向电场, 比例系数为霍尔系数
  - 可用于直接测量载流子类型和浓度

$$E = \frac{JB}{\pm nq} = R_H JB$$

- p型半导体与n型半导体的霍耳系数方向相反
- 载流子浓度越小,霍耳系数越大